

УДК 537.533

© 1991

ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННАЯ ДЕСОРБЦИЯ АТОМОВ ЛИТИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМА, ПОКРЫТОЙ ПЛЕНКОЙ ОКИСЛА

B. Н. Агеев, Ю. А. Кузнецов, Н. Д. Потехина

С помощью времяпролетной техники исследована электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) атомов лития с поверхности вольфрама, покрытой пленкой окисла. Впервые обнаружено, что литий может адсорбироваться на поверхности окисла вольфрама при температуре подложки $T=77$ К в физадсорбированном и неравновесном хемосорбированном состояниях. ЭСД атомов лития из физадсорбированного состояния происходит в результате ионизации адатомов лития и межатомной Оже-нейтрализации при их движении к поверхности, а из хемосорбированного — в результате ионизации 2s-электронов кислорода подложки и внутриатомной Оже-нейтрализации с переходом в обоих случаях в антисвязанное состояние. Поперечные сечения и энергораспределение атомов лития при ЭСД объяснены на основе модели релаксации локального поля поверхности.

Электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) является мощным методом анализа и изменения состояния адсорбированных слоев [1]. Однако практическое использование этого явления сдерживается недостаточным уровнем понимания его механизма, что в значительной мере связано с малочисленностью прямых измерений потоков нейтральных частиц при ЭСД. Нам впервые удалось зарегистрировать потоки нейтральных частиц при ЭСД [2], измерить их энергораспределения (ЭР) [3] и объяснить зависимость распределений от температуры подложки [4]. Мы обнаружили, что ЭР атомов лития(Li) при ЭСД зависят от степени окисления поверхности вольфрама (W), энергии бомбардирующих поверхность электронов, концентрации напыленного лития, а также от температур подложки при напылении и ЭСД. На основании этих данных мы пришли к выводу о существовании на окисленном вольфраме при $T=77$ К физически и химически адсорбированных форм лития [5]. В настоящей работе описываются дальнейшие эксперименты по изучению ЭСД атомов Li из физадсорбированного и хемосорбированного состояний.

1. Экспериментальная техника

Экспериментальный прибор и методика измерений подробно описаны ранее [3]. ЭР атомов Li при ЭСД измерялись времяпролетным методом с помощью детектора на основе поверхностной ионизации. В качестве мишени служила текстурированная W-лента размерами $64 \times 2 \times 0.01$ мм с преимущественным выходом на поверхность грани (100), которая предварительно экспонировалась в кислороде при давлении $\sim 10^{-6}$ Торр либо при температуре 1550 К для создания монослойного покрытия атомарного кислорода, либо при $T=1100$ К до образования объемной пленки окисла [6]. Литий напылялся на мишень из прямонакального испарителя, в котором окись лития восстанавливалась алюминием; концентрация напыленного лития определялась по времени напыления при постоянной

интенсивности потока, величина которой измерялась по току поверхностной ионизации. Концентрация лития в монослое принималась равной 10^{15} ат./см². Мишень могла охлаждаться до $T=77$ К путем охлаждения токоподводов в жидким азотом [4].

2. Результаты измерений

На рис. 1, а представлены графики нормированных ЭР атомов Li при бомбардировке электронами с энергией $E_e=80$ эВ поверхности вольфрама с пленкой окисла для различных степеней покрытия поверхности

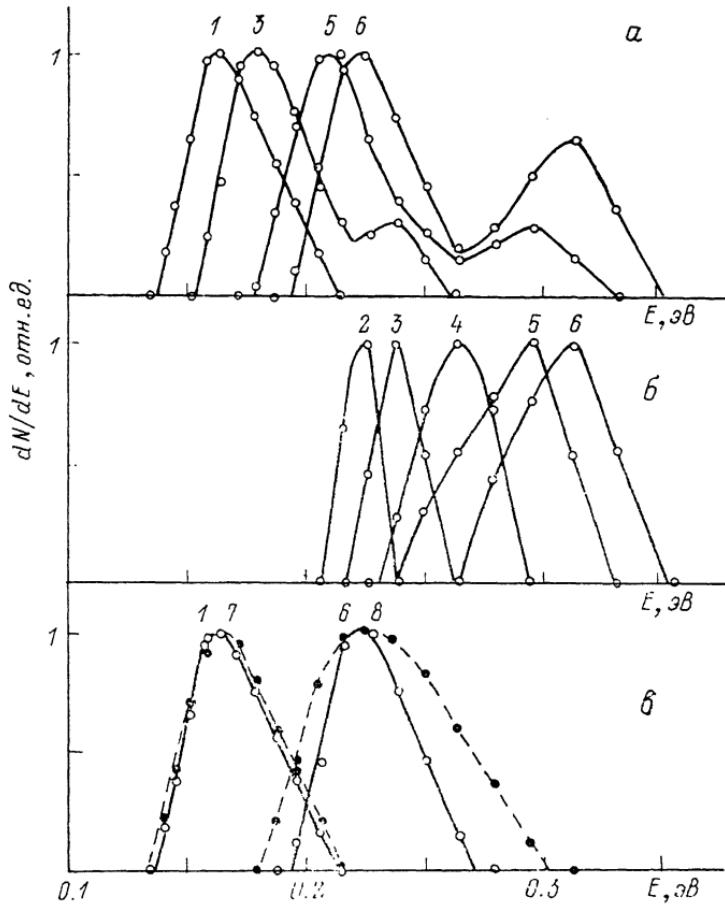


Рис. 1. Нормированные графики полных ЭР (а), ВЭ пика в ЭР (б) и НЭ пика в ЭР (в) атомов Li при ЭСД с поверхности вольфрама, покрытого пленкой окисла, измеренные при $T=77$ К для различных величин Θ ($E_e=80$ эВ).

Θ : 1, 7 — 0.875; 2 — 0.75; 3 — 0.625; 4 — 0.5; 5 — 0.25; 6, 8 — 0.125. Температура подложки при напылении слоя лития составляла 77 (1—6) и 300 К (7, 8).

литием Θ при температуре подложки 77 К. Видно, что при $\Theta < 0.875$ ЭР имеют вид кривых с двумя максимумами: низкоэнергетическим (НЭ) и высокоэнергетическим (ВЭ), которые с ростом Θ смещаются в область меньших энергий с уменьшением зазора между максимумами. При $\Theta \geq 0.875$ ВЭ пик исчезает и ЭР превращаются в колоколообразные кривые с одним максимумом. Кроме того, этот ВЭ пик в ЭР атомов Li исчезает при энергиях электронов $E_e < 55$ эВ или после отогрева до $T=300$ К слоя Li, напыленного при $T=77$ К [5]. Этот пик отсутствовал также при любых E_e и температурах подложки, если слой Li был нанесен на поверхность вольфрама, покрытого монослоем кислорода [4]. На рис. 1, б изображены нормированные графики ВЭ пика для различных Θ , полученные графическим разделением пиков на рис. 1, а. Видно, что с ростом Θ ВЭ пик не только смещается в область меньших энергий, но и сужается, ста-

новясь более симметричным относительно максимума. С другой стороны, форма НЭ пика в ЭР (рис. 1, б) практически не изменяется с ростом Θ при его смещении в область меньших энергий. Если слой Li напылять при $T=300$ К, а затем охладить подложку до $T=77$ К (штриховые кривые на рис. 1, б), то ВЭ пик в ЭР отсутствует, НЭ пик слегка расширяется, а его максимум несколько смещается в область больших энергий при $\Theta < 0.875$ по сравнению с ЭР из слоя лития, напыленного при $T=77$ К. С ростом Θ одновременно со смещением НЭ пика в область меньших энергий происходит его сужение, и при $\Theta \approx 0.875$ ЭР спектры, полученные после напыления лития на подложку при $T=77$ К и после отжига при $T=300$ К и охлаждения до $T=77$ К, становятся идентичными. После отжига пленок Li при $T=300$ К изменение температуры подложки при измерении ЭСД в диапазоне $77 \text{ K} < T < 300 \text{ K}$ приводит к обратимым изменениям ЭР, вызванным распределением атомов Li по колебательным

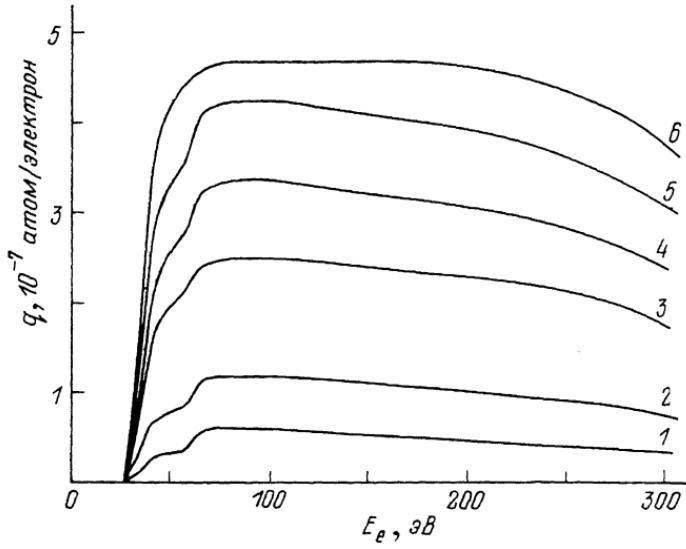


Рис. 2. Зависимости выхода q атомов Li при ЭСД с поверхности вольфрама, покрытого пленкой окисла, от энергии электронов для различных величин Θ ($T=77$ К).

Θ : 1 — 0.125, 2 — 0.25, 3 — 0.5, 4 — 0.625, 5 — 0.75, 6 — 0.875.

состояниям [4], что позволяет нам назвать возникшее после прогрева до 300 К состояние адслоя равновесным, а состояние до прогрева — неравновесным.

На рис. 2 представлены зависимости выхода q атомов Li от энергии E_e , бомбардирующих мишень электронов для различных величин Θ при температуре 77 К. Порог появления ЭСД атомов Li не зависит от Θ и равен ~ 25 эВ, т. е. близок к энергии ионизации уровня O(2s). При энергии электронов ~ 55 эВ, которую можно сопоставить с энергией ионизации уровня Li(1s), на зависимостях $q=f(E_e)$ наблюдается отчетливый перегиб, если $\Theta < 0.875$. Перегиб исчезает после отогрева напыленного при $T=77$ К слоя лития до $T=300$ К и отсутствует при ЭСД атомов Li с вольфрамом, покрытого монослоем кислорода [5]. Следовательно, имеется отчетливая корреляция в появлении ВЭ пика в ЭР атомов Li и перегиба на зависимостях $q=f(E_e)$ при $E_e \sim 55$ эВ: этот ВЭ пик ЭСД атомов Li существует только в неравновесном состоянии адслоя для покрытий $\Theta < 0.875$, а проявляется в ЭСД лишь при $E_e > 55$ эВ.

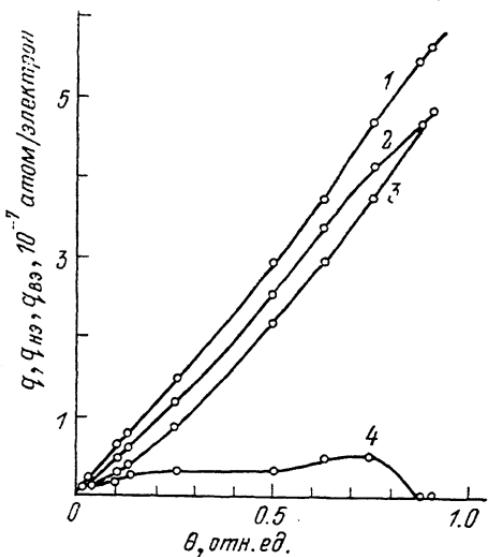
На рис. 3 приведены зависимости полного выхода q атомов Li при ЭСД от степени покрытия Θ литием монослойной пленки кислорода (кривая 1) и пленки окисла (кривая 2) на вольфраме при $T=77$ К. Кривые 3, 4 — зависимости выхода $q_{\text{нэ}}$ и $q_{\text{вэ}}$ атомов Li с низкой и высокой энергией с окисной пленкой соответственно. Видно, что выход q атомов Li при одинаковых Θ выше с монослойной пленкой кислорода, чем с пленкой окисла.

В обоих случаях q возрастает с ростом Θ несколько быстрее, чем линейно, причем для подложки с окисной пленкой по крайней мере при $\Theta > 0.125$ этот рост в основном связан с увеличением выхода атомов Li с низкой энергией.

Для определения зависимости от Θ поперечных сечений $Q_{\text{ВЭ}}$, $Q_{\text{НЭ}}$ и концентрации лития $N_{\text{ВЭ}}$, $N_{\text{НЭ}}$ в состояниях, приводящих к ЭСД атомов Li с высокой и низкой энергией, используем замеченный нами факт, что после нагрева адслоя Li, напыленного при 77 К, на 30–50 К и последующего охлаждения снова до 77 К ВЭ пик исчезал, а интенсивность НЭ пика увеличивалась

Рис. 3. Зависимости выхода атомов Li при ЭСД от степени покрытия литием при $T=77$ К поверхности вольфрама, покрытого монослойной пленкой кислорода (1) и пленкой окисла (2–4).

1, 2 — полный выход q атомов Li; 3 — выход $q_{\text{НЭ}}$ атомов Li в НЭ пике ЭР; 4 — выход $q_{\text{ВЭ}}$ атомов Li в ВЭ пике ЭР.



лась без изменения его формы, т. е. происходил переход лития из ВЭ состояния в НЭ. Полагая, что прогрев не вызывал термодесорбции лития, можно было найти зависимость выхода и поперечные сечения ЭСД атомов Li из этого неравновесного состояния.

Мы предполагаем далее, что после прогрева на 30–50 К и перехода всех атомов Li в НЭ состояние природа НЭ состояния, а следовательно, и поперечное сечение $Q_{\text{НЭ}}$ ЭСД остаются такими же, как до прогрева. Зависимость $Q_{\text{НЭ}}(\Theta)$ изображена кривой 1 на рис. 4. Кривая 2 (рис. 4)

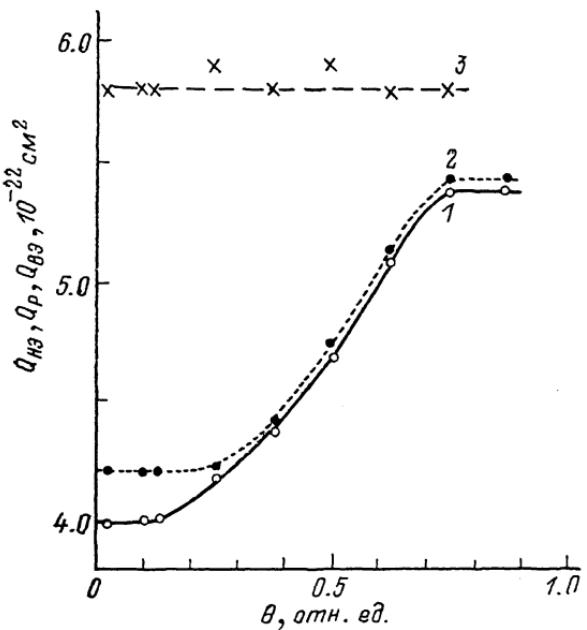


Рис. 4. Зависимости поперечных сечений ЭСД атомов Li с поверхности вольфрама, покрытого пленкой окисла от степени покрытия поверхности литием при $T=77$ К ($E_e=80$ эВ).

1 — $Q_{\text{НЭ}}$, 2 — Q_P , 3 — $Q_{\text{ВЭ}}$.

дает зависимость сечения $Q_p(\Theta)$, полученного из измерения ЭСД атомов Li при $T=77$ К после предварительного прогрева слоя до 300 К. Видно, что отличие $Q_p(\Theta)$ от $Q_{\text{НЭ}}(\Theta)$ имеется лишь в области малых покрытий при $\Theta < 0.25$, что позволяет считать неравновесное и равновесное состояния, ответственные за НЭ пик, близкими по своей природе.

Зная $Q_{\text{НЭ}}(\Theta)$ и выход $q_{\text{НЭ}}(\Theta)$ (рис. 3), найдем $N_{\text{НЭ}} = q_{\text{НЭ}}/Q_{\text{НЭ}}$, а следовательно, и $N_{\text{ВЭ}}(\Theta) = N - N_{\text{НЭ}}(\Theta)$, где N — полная концентрация атомов Li. На рис. 5 изображены полученные таким способом зависимости

от Θ относительной доли атомов Li в состояниях, отвечающих за ВЭ и НЭ пики ЭР при $T=77$ К. Видно, что доли атомов Li в этих состояниях с ростом Θ изменяются синхронно ступенчатым образом. При $\Theta < 0.125$ примерно 65 % Li адсорбируется в НЭ состоянии и 35 % — в состоянии, отвечающем за ВЭ пик ЭР. В диапазоне $0.125 < \Theta < 0.4$ доля атомов Li в первом состоянии увеличивается до 90 % и соответственно во втором падает до 10 %. Затем в области $0.4 < \Theta < 0.75$ соотношение концентраций в этих состояниях остается постоянным, и, наконец, при $\Theta > 0.75$ состояние с высокими энергиями атомов Li при ЭСД постепенно исчезает.

Зная зависимость от Θ концентрации $N_{\text{ВЭ}}$ адатомов лития и выхода $q_{\text{ВЭ}}(\Theta)$ атомов Li при ЭСД из состояния с высокими энергиями, можно было найти величины попечерных сечений $Q_{\text{ВЭ}} = q_{\text{ВЭ}}/N_{\text{ВЭ}}$ из этого состояния для различных Θ . Оказалось, что $Q_{\text{ВЭ}}$ не зависит от Θ и при $E_e = -80$ эВ $Q_{\text{ВЭ}} = 5.8 \cdot 10^{-22} \text{ см}^2$ (прямая 3 на рис. 4).

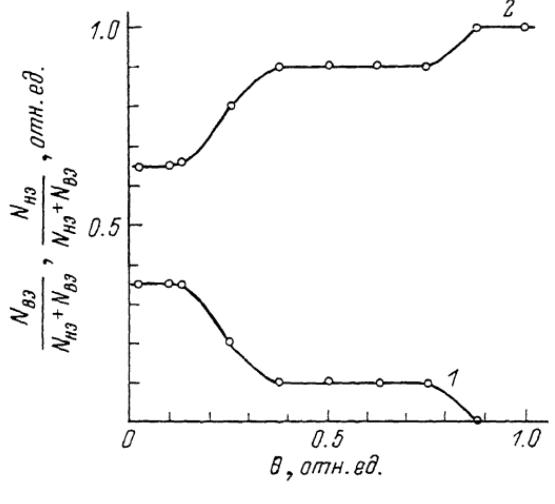


Рис. 5. Зависимости относительной доли атомов Li, адсорбированных на поверхности вольфрама, покрытого пленкой окисла, от степени покрытия поверхности литием при $T=77$ К.

1 — в состоянии с высокой энергией атомов лития при ЭСД, 2 — в неравновесном состоянии с низкой энергией атомов лития при ЭСД.

3. Обсуждение результатов

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что литий на поверхности окисла вольфрама при $T=77$ К адсорбируется в неравновесных, температурно-необратимых состояниях. Действительно, учитывая, что ВЭ пик в ЭР атомов Li при ЭСД необратимо исчезает уже при нагреве адслоя лития от 77 до ~ 120 К (рис. 1, в) и порог его появления $E_e \sim 55$ эВ близок к энергии ионизации уровня Li (1s), логично его связать с ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния [5]. Тогда НЭ пик атомов Li в ЭР можно отнести к ЭСД атомов Li из хемосорбированного состояния. Следовательно, увеличение интенсивности НЭ пика атомов Li при одновременном уменьшении интенсивности ВЭ пика в результате отжига адслоя Li при $T \sim 120$ К происходит из-за необратимого перехода лития из физадсорбированного в хемосорбированное состояние. С увеличением концентрации напыленного лития усиливается взаимодействие между адатомами с одновременным ослаблением связи адатом—поверхность. Это приводит к уменьшению потенциального барьера между физадсорбированным и хемосорбированным состояниями, и при $\Theta \geq 0.875$ все физадсорбированные атомы уже при $T=77$ К переходят в хемосорбированное состояние. На этом основании предполагалось, что ВЭ и НЭ пики возникают при ЭСД Li из физ- и хемосорбированных состояний и соответственно $Q_{\text{НЭ}} \equiv Q_{\text{хем}}$, $Q_{\text{ВЭ}} \equiv Q_{\phi}$.

Необратимое изменение формы НЭ пика атомов Li при $\Theta < 0.875$ после отжига адслоя при $T=300$ К (рис. 1, в, кривые 6, 8) свидетельствует о неравновесном характере хемосорбированного состояния Li, существовавшего до отжига на окисле вольфрама. При $\Theta \geq 0.875$ латеральные взаимодействия в адслое обеспечивают установление термического равновесия уже при $T < 300$ К, что вытекает из независимости от отжига при этих Θ формы НЭ пика (рис. 1, в) и попечерного сечения ЭСД атомов Li $Q_{\text{НЭ}}(\Theta)$.

Адсорбция лития при $T=77$ К на поверхности вольфрама, покрытого монослойной пленкой кислорода, в отличие от случая окисла вольфрама приводит к появлению только одного пика в ЭР атомов Li, форма которого с изменением T изменялась обратимо в диапазоне $77 < T < 300$ К [4]. Это качественное отличие в температурных зависимостях ЭСД атомов Li на монослойной пленке кислорода и пленке окисла на W, по-видимому, является следствием меньшей химической активности кислорода в окисной форме, где кислород имеет больший отрицательный заряд и более замкнутую электронную оболочку, чем в хемосорбированном монослое, что и обеспечивает возможность физической адсорбции лития на поверхности окисла.

Последовательность электронных переходов, приводящих к ЭСД атомов Li из физ- и хемосорбированных состояний, может быть качественно рассмотрена с помощью схемы потенциальных кривых на рис. 6.

Исходя из предположения, что в хемосорбированном состоянии $U_0(x)$ литий находится в виде положительных ионов, и из того факта, что порог появления ЭСД атомов Li из этого состояния (~ 25 эВ) соответствует энергии ионизации уровня O(2s), мы заключаем, что в этом случае нейтральные частицы при ЭСД образуются в результате внутриатомного Оже-распада оставной вакансии O(2s), приводя к состоянию $U_2(O^0 + Li^0)$ на рис. 6, а через Оже-нейтрализацию. Десорбция нейтралей, однако, становится возможной лишь после релаксации заряда на кислороде за счет электронов подложки $O^0 \rightarrow O^{2-}$, переводящей систему в отталкивательное состояние $U_1(O^{2-} + Li^0)$. Но из состояния $U_2(x)$ может происходить также переход в основное состояние $U_0(x)$ в результате реионизации атома Li на атоме кислорода. Предполагаем, что в состоянии $U_1(x)$ реионизация маловероятна из-за насыщения поверхности электронами, и пренебрегаем ею. С учетом указанных процессов поперечное сечение $Q_{\text{хем}}$ ЭСД атомов, находившихся в хемосорбированном состоянии, можно записать в виде [7]

$$Q_{\text{хем}} = Q_{\text{ex}}[O(2s)]w(1 - w_1), \quad (1)$$

где $Q_{\text{ex}}[O(2s)]$ — сечение ионизации уровня O(2s); w — вероятность нейтрализации иона Li^+ в результате Оже-распада дырки на уровне O(2s); w_1 — полная вероятность реионизации атома Li за время его движения вдоль кривой $U_2(x)$.

На опыте наблюдается рост $Q_{\text{хем}}(Q_{\text{НЭ}} \text{ и } Q_P)$ с ростом Θ (рис. 4, кривые 1, 2). Из общих соображений $Q_{\text{ex}}[O(2s)]$ и w в (1) могут только уменьшаться с ростом Θ : Q_{ex} из-за экранировки кислорода литием, а w — из-за уменьшения заряда адионов Li^+ и увеличения их равновесного расстояния от поверхности с ростом покрытия. Следовательно, рост $Q_{\text{хем}}$ при $\Theta > 0.25$ для Q_P и $\Theta > 0.125$ для $Q_{\text{НЭ}}$ вызывается уменьшением вероятности реионизации w_1 с ростом Θ , что также можно объяснить увеличением равновесного расстояния адслоя Li от поверхности вследствие латеральных взаимодействий между адчастичками. Для неравновесного хемосорбированного слоя Li увеличение сечения $Q_{\text{НЭ}}$ с ростом Θ начинается уже при $\Theta \geq 0.125$ (рис. 4), вероятно, из-за ограниченности при $T=77$ К перемещения лития вдоль поверхности и проявления латеральных взаимодействий при меньших Θ . Отсутствие зависимости $Q_{\text{хем}}$ от Θ , когда напыление лития и осуществление ЭСД проводились при температуре подложки 300 К, объясняется, по-видимому, быстрым восстановлением отрицательного заряда на кислороде за счет увеличения свободных электронов в подложке с ростом T и соответственно малой вероятностью w_1 независимо от равновесного расстояния адатомов Li от поверхности.

При обсуждении зависимости от Θ ЭР атомов Li, образованных в результате ЭСД из хемосорбированного состояния, заметим, что, поскольку их начальная скорость мала, а ускорение в потенциале $U_2(x)$ очень слабое, за малое время релаксации ($\sim 10^{-16}$ с) переход $U_2 \rightarrow U_1$ произойдет в окрестности начальной координаты. Тогда при $T \rightarrow 0$ рас-

пределение частиц по энергиям является «отражением» волновой функции нулевого уровня $|\Psi_0(x)|^2$ или распределения $N_a(x)$ при $T \neq 0$ на кривой $U_1(x)$ [8]

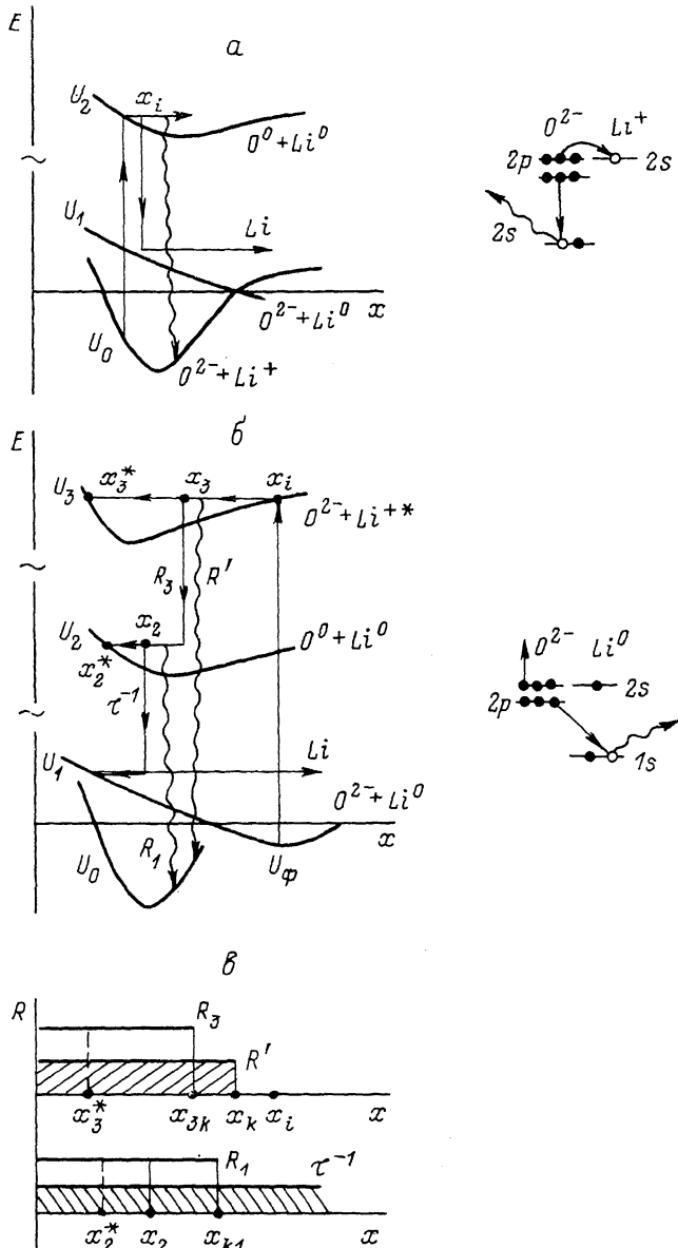


Рис. 6. Схема потенциальных кривых для состояний химической (a) и физической (b) адсорбции Li на поверхности вольфрама, покрытого пленкой окисла, а также аппроксимация вероятностей переходов ступенчатыми функциями (c).

$$\frac{dN(E)}{dE} \sim N_a(x) \left| \frac{dU_1(x)}{dx} \right|_{x=x(E)},$$

$$N_a(x) = N_a^0 \sum_i g_i |\Psi_i(x)|^2 \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right) \left| \sum_i g_i \exp\left(-\frac{E_i}{kT}\right) \right|,$$

где N_a^0 — полное число хемосорбированных частиц; g_i , $\Psi_i(x)$ — статвес и волновая функция i -го колебательного состояния системы.

Сдвиг с ростом Θ кривой $U_0(x)$ за счет латеральных взаимодействий вправо объясняет сдвиг ЭР на рис. 1, в в сторону меньших энергий, если

терм $U_1(x)$ с ростом Θ не меняется. Интересно отметить разницу в ЭР атомов Li при ЭСД из неравновесного и равновесного слоя. В первом случае ЭР с ростом Θ смещаются в область меньших энергий практически без изменения формы (кривые 1, б на рис. 1, в), так же как в случае ЭСД атомов Li с монослоиной пленки кислорода на W [4], где сохранение формы объясняли случайной компенсацией расширения $U_0(x)$ (и $|\Psi_i(x)|^2$) с ростом Θ и уменьшения dU_1/dx с ростом x . Во втором, равновесном, случае ЭР сужаются с ростом Θ , хотя смещение максимума остается таким же, как и в [4]. И если при малых Θ ЭР в равновесном случае шире, чем в неравновесном, то при $\Theta > 0.75$ они практически неотличимы (рис. 1, в). Расширение ЭР при малых Θ после прогрева неравновесного хемосорбированного слоя от $T=77$ до 300 К и последующего охлаждения вновь до $T=77$ К (кривая 8 на рис. 1, в) формально соответствует расширению потенциальной кривой основного состояния $U_0(x)$ в результате этой процедуры, что физически трудно объяснить, тем более что из совпадения положения максимумов ЭР должно вытекать отсутствие разницы в термах $U_1(x)$ и в сдвиге $U_0(x)$ с ростом Θ для неравновесной и равновесной хемосорбции.

Высокоэнергетический пик ЭР, как было отмечено выше, возникает только при $E_e > 55$ эВ и $T=77$ К, что мы связали с десорбцией из физадсорбированного состояния атомов Li в результате ионизации уровня Li (1s) в соответствии со схемой рис. 6, б. Заметим, что ионизация 1s уровня иона Li⁺ в хемосорбированном состоянии не приводит к ЭСД атома Li. В этом случае образуется Li^{2+*} (1s) и для его нейтрализации нужны 2 электрона. Этот процесс маловероятен. Ионизация физадсорбированного атома Li с сечением Q_{ex} [Li (1s)] переводит систему из начального состояния $U_\phi(x_i)$ в возбужденное O²⁻ + Li^{2+*} с потенциальной энергией $U_3(x_i)$, которая на рис. 6, б приближенно соответствует энергии иона в поле сил изображения. В результате притяжения метастабильный ион Li^{2+*} (1s2s) движется к поверхности до некоторого расстояния x_{3k} , после достижения которого растет как вероятность $R_3(x)$ межатомного Оже-распада O²⁻ (2p) → Li^{2+*} (1s) с выбыванием одного из валентных электронов кислорода и переходом системы в состояние O⁰+Li⁰ ($U_3 \rightarrow U_2$), так и вероятность резонансной нейтрализации $R'(x)$ Li^{2+*} (1s2s) за счет перехода электрона подложки на уровень Li^{*} (2p), находящийся после ионизации Li (1s) ниже уровня Ферми. В образовавшемся атоме Li^{*} происходят де-возбуждение 2p → 1s и удаление 2s электрона за счет выделившейся энергии. Система оказывается в основном состоянии $U_0(x)$ (O²⁻ + Li⁺). Оба перехода связаны с межатомными электронными процессами, и поэтому их вероятности $R_3(x)$ и $R'(x)$ должны сильно зависеть от расстояния x . При переходе $U_3 \rightarrow U_2$ сохраняется кинетическая энергия $E_3(x) = -U_3(x_i) - U_3(x)$, позволяющая продолжить движение атома Li к поверхности вдоль $U_2(x)$, во время которого в свою очередь также возможны 2 процесса: рекомбинация атома Li с вероятностью $R_1(x)$ (переход $U_2 \rightarrow U_0$) и релаксация заряда на кислороде за счет электронов подложки с вероятностью $R_2 = 1/\tau$, что приводит к переходу на отталкивательную ветвь физадсорбированного состояния $U_2 \rightarrow U_1$. Здесь τ — время жизни атома кислорода в окисле вольфрама в состоянии O⁰.

Как и в случае хемосорбции, в состоянии $U_1(x)$ пренебрегаем рекомбинацией атома Li и примем вероятность его десорбции с этой ветви $P_0 \approx 1$, хотя атомы Li при ЭСД из физадсорбированного состояния за счет кинетической энергии, полученной в поле сил изображения, могут приблизиться к поверхности вдоль кривой $U_1(x)$ ближе, чем x_0 — равновесное расстояние O²⁻—Li⁺ при хемосорбции (рис. 6, б), что и приводит к сдвигу ЭР при ЭСД из физадсорбированного состояния в сторону больших энергий по сравнению с ЭСД из хемосорбированного состояния (рис. 1).

С учетом всех вышеуказанных процессов по аналогии с работами [8-12] запишем выражения для ЭР и сечения ЭСД атомов Li, образованных в результате ионизации физадсорбированного атома.

Вероятность частицы, образованной в точке x_i , оставаться на кривой U_3 при движении до x_3 равна

$$P_3(x_i, x_3) = \exp \left[- \int_{x_i}^{x_3} \frac{R'(x) + R_3(x)}{v_3(x_i, x_3)} dx \right]. \quad (2)$$

Соответственная величина на кривой $U_2(x)$ есть

$$P_2(x_3, x_2) = \exp \left[- \int_{x_3}^{x_2} \frac{\tau^{-1} + R_1(x')}{v_2(x_i, x_3, x_2)} dx' \right], \quad (3)$$

где $v_3(x_i, x_3)$, $v_2(x_i, x_3, x_2)$ — скорости частицы, созданной в x_i при ее движении вдоль $U_3(x)$ до x_3 и при последующем движении вдоль $U_2(x)$ от x_3 до x_2 соответственно. Учитывая (2) и (3), запишем вероятность возбужденной в точке x_i частице оказаться в точке x_2 на $U_1(x)$ (в предположении лишь ее движения к поверхности)

$$G(x_i, x_2) dx_2 = \left[\int_{x_3}^{x_2} \frac{R_3(x_3) \tau^{-1} P_3(x_i, x_3) P_2(x_3, x_2)}{|v_3(x_i, x_3) v_2(x_i, x_3, x_2)|} dx_3 \right] dx_2, \quad (4)$$

которая после подстановки зависимости $x_2(E)$ определит форму ЭР десорбированных частиц. Кинетическая энергия атома, оказавшегося после переходов в x_i , x_3 , x_2 на кривой $U_1(x)$ в точке x_2 , равна

$$E(x_2) = E_0(x_i) + U_3(x_i) - U_3(x_3) - U_2(x_3) + U_2(x_2) + U_1(x_2), \quad (5)$$

где $E_0(x_i)$ — начальная кинетическая энергия, причем x_2 зависит от x_i через скорость, приобретенную на участке (x_i, x_3) кривой $U_3(x)$. Теперь заметим, что (4) и (5) определяют распределение по энергиям частиц, образованных в точке x_i , в случае классического описания их движения при $T=0$. Так как $R'(x)$, $R_1(x)$ и $R_3(x)$ экспоненциально растут с уменьшением x , а функции P_2 и P_3 уменьшаются подобным образом, по мере приближения x_3 и x_2 к поверхности, то их произведение в (4) приводит к ЭР в форме колокола, даже если все частицы образованы в одной начальной точке x_i [8-11].

Учет их начального распределения по x_i как за счет теплового движения при $T > 0$, так и за счет квантовомеханического распределения $\sim |\Psi_0(x_i)|^2$ при $T=0$ даст наложение одной гауссианы на другую при используемом нами классическом описании. При квантовомеханическом описании надо было бы найти эволюцию начального волнового пакета во времени с учетом всех указанных выше переходов по аналогии с рассмотрением ЭСД из физадсорбированных слоев на металлах в работах [9-11]. Сложность нашей схемы (рис. 6) при ЭСД атомов Li с окисленного вольфрама не позволяет выполнить полный расчет даже в рамках классического приближения, поэтому мы проведем качественное обсуждение экспериментальных результатов по измерению сечения Q_ϕ и ЭР атомов Li из физадсорбированного состояния. В классическом случае с учетом (2), (3) и схемы (рис. 6, б) сечение ЭСД атомов, образованных в результате ионизации физадсорбированного состояния в точке x_i , запишется в виде

$$Q_\phi(x_i) = Q_{ex} [\text{Li}(1s)] \int_{x_i}^{x_3^*} \frac{R_3(x_3) P_3(x_i, x_3)}{|v_3(x_i, x_3)|} w_2(x_3, x_2^*) dx_3, \quad (6)$$

где x_3^* — точка поворота траектории в потенциале $U_3(x)$; $Q_{ex} [\text{Li}(1s)]$ — сечение ионизации уровня 1s в адатоме Li,

$$w_2(x_3, x_2^*) = \tau^{-1} \int_{x_3}^{x_2^*} \frac{P_2(x_3, x)}{|v_2(x_i, x_3, x)|} dx \quad (7)$$

— вероятность перехода с $U_0(x)$ на $U_1(x)$ при движении от x_3 к поверхности до точки классического отражения x_2^* (обратным движением вдоль U_3 и U_2 здесь пренебрегаем). При учете распределения $N_\phi(x_i)$ адатомов по x_i в начальном состоянии для сечения ЭСД атомов Li и их ЭР имеем соответственно

$$Q_\phi(\Theta) = \int_0^\infty Q_\phi(x_i) N_\phi(x_i) dx_i, \quad (8)$$

$$\frac{dN}{dE} = Q_{ex}[\text{Li}(1s)] \int_0^\infty G(x_i, x_2) N_\phi(x_i) dx_i \left(\frac{dE}{dx_2} \right)^{-1} dE, \quad (9)$$

где при вычислении dE/dx_2 и $x_2(E)$ из (5) необходимо также учесть связь между x_2 и x_i .

Формулы (2)–(9), так же как и рис. 6, б, могут послужить основой для анализа зависимостей от Θ сечения $Q_\phi(x_i)$ и энергораспределения ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния. Из экспериментальных результатов следует, что большая часть атомов Li на поверхности окисла вольфрама находится в хемосорбированном ионном состоянии (рис. 5), доля которого растет с ростом Θ , приводя к отталкиванию возбужденного Li^{+*} от соседних ионов Li^+ . Поэтому кривая $U_3(x)$ с ростом Θ повышается и становится более плоской, так как отталкивание сильнее для малых x . Это должно привести к уменьшению энергии (5) вылетающей частицы, оказавшейся в точке x_2 на отталкивательной ветви $U_1(x)$ после процессов в точках x_i, x_3, x_2 на рис. 6, б. На кривых $U_2(x)$ и $U_1(x)$ рост Θ сказывается значительно слабее, так как адатом Li в этих состояниях нейтрален. Эти рассуждения качественно объясняют сдвиг ЭР в сторону меньших энергий и его сужение с ростом Θ , а также асимметрию ЭР в сторону меньших энергий в отличие от случая хемосорбции, где ЭР затянуты в сторону больших энергий (рис. 1, б). Переайдем к обсуждению $Q_\phi(\Theta)$. Уменьшение с ростом Θ запасенной на пути от x_i до x_3 кинетической энергии уменьшает скорости $v_3(x)$ и $v_2(x)$ в выражениях (2)–(7), связанные с ними заселенности состояний $P_3(x_i, x_3), P_2(x_3, x_2)$ и интервалы интегрирования в (6), (7) из-за удаления точек x_3^* и x_2^* от поверхности при уменьшении скоростей движения.

Экспоненциальное спадание с ростом x вероятностей процессов, связанных с электронными переходами адатом—подложка, $R_1(x), R'(x), R_3(x)$, заменим для простоты обсуждения ступеньками различной величины и протяженности (рис. 6, в). С учетом этих факторов можно сделать следующие заключения. Удаление точки x_2^* от поверхности за счет уменьшения E с ростом Θ уменьшает долю переходов $U_2 \rightarrow U_0$, так как уменьшается область (x_2^*, x_{k1}) эффективной реконионизации с ростом Θ , а это увеличивает в (6) вероятность w_2 перехода $U_2 \rightarrow U_1$ для частицы, образованной в точке x_3 . На опыте, однако, Q_ϕ не зависит от Θ (рис. 4). Это значит, что множитель перед $w_2(x_3, x_2^*)$ в подынтегральном выражении (6), определяющий долю переходов $U_3 \rightarrow U_2$, должен с ростом Θ уменьшаться, компенсируя рост $w_2(x_3, x_2^*)$. Такое уменьшение доли переходов $U_3 \rightarrow U_2$ может наблюдаться, если переходы $U_3 \rightarrow U_0 (R')$ начинаются при движении вдоль $U_3(x)$ к поверхности раньше, чем межатомный Оже-процесс, ведущий к переходу $U_3 \rightarrow U_2$ с вероятностью $R_3(x)$. Тогда уменьшение средней скорости $v_3(x)$ увеличивает долю переходов $U_3 \rightarrow U_0$ за счет того участка пути, где еще нет переходов на $U_2(x)$. Такая разница в зависимостях $R'(x)$ и $R_3(x)$ действительно должна иметь место, так как $R'(x)$ связана с перекрыванием валентных функций O(2p) и Li⁺(1s), а переход $R_3(x)$ — с началом взаимодействия O(2p) и Li⁺(1s), которое возможно при большем сближении с поверхностью.

Что касается формы ЭР (9) при ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния (рис. 1, б), то в отличие от НЭ пика (рис. 1, в) на нее сильное

влияние должно оказывать движение атома к поверхности вдоль $U_2(x)$ из-за гораздо большей, чем на рис. 6, *a*, кинетической энергии атома, запасенной при движении вдоль $U_3(x)$. На обычную гауссиану здесь наложится функция $G(x_i, x_2)$, спадающая (при схеме рис. 6) с ростом пути (x_3, x_2) атома Li вдоль кривой $U_2(x)$, а это сделает более резким спад ЭР в сторону больших энергий. И действительно, на рис. 1, *b* такая асимметрия ЭР отмечается и наиболее заметна при малых Θ , где запас кинетической энергии больше, так как по мере роста Θ кривая $U_3(x)$ становится более плоской, скорость движения, а следовательно, и влияние $G(x_i, x_2)$ в (9) уменьшаются и ЭР становится более симметричным.

Таким образом, качественно все наблюдаемые особенности ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния могут быть объяснены с помощью предложенной в [5] и уточненной здесь схемы протекающих при этом процессов. Мы видим, что сопоставление с опытом позволяет сделать некоторые заключения о соотношении между областями наибольшей эффективности различных переходов. Так, из нашего рассмотрения вытекает, что $x_{3k} < x_{k1} < x_k$ для начала роста функций $R_3(x)$, $R_1(x)$ и $R'(x)$ по мере приближения к поверхности, что не противоречит и физической природе этих переходов.

Анализ ЭР атомов Li при ЭСД с окисленной поверхности вольфрама в зависимости от изменений T и Θ позволил сделать следующие заключения о структуре адслоя Li и физических процессах при ЭСД атомов Li в различных условиях, позволяющие качественно объяснить эксперимент.

1. Литий на окисле вольфрама в отличие от моноатомной пленки кислорода на вольфраме [4] при $T=77$ К адсорбируется в неравновесном хемосорбированном и физадсорбированном состояниях, а по мере роста T сначала происходит его переход из физадсорбированного состояния в неравновесное хемосорбированное, а затем в равновесное хемосорбированное. При $\Theta \geqslant 0.875$ весь литий переходит в хемосорбированное состояние.

2. ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния происходит в результате ионизации адатомов Li и межатомной Оже-нейтрализации при их движении к поверхности, а их хемосорбированного — в результате ионизации 2s-электронов кислорода подложки и внутриатомной Оже-нейтрализации с переходом в обоих случаях в антисвязанное конечное состояние. Возможно, что реверсивное движение является уникальной особенностью ЭСД нейтралей из физадсорбированных систем [13, 14].

3. Поперечное сечение ЭСД атомов Li из физадсорбированного состояния не зависит от Θ , а из хемосорбированного увеличивается вследствие уменьшения вероятности рекомбинации атомов Li из-за латеральных взаимодействий.

4. Энергораспределения нейтралей при ЭСД исключительно чувствительны к состоянию адсорбционных систем.

Список литературы

- [1] Агеев В. Н., Бурмистрова О. П., Кузнецов Ю. А. // УФН. 1989. Т. 158. № 3. С. 389—420.
- [2] Агеев В. Н., Кузнецов Ю. А., Якшинский Б. В. // ФТТ. 1982. Т. 24. № 2. С. 349—355.
- [3] Агеев В. Н., Бурмистрова О. П., Кузнецов Ю. А. // ФТТ. 1987. Т. 29. № 6. С. 1740—1746; Поверхность. 1988. № 7. С. 28—34.
- [4] Агеев В. Н., Бурмистрова О. П., Кузнецов Ю. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 9. С. 91—96.
- [5] Агеев В. Н., Кузнецов Ю. А. // Письма в ЖТФ. 1990. Т. 16. № 5. С. 38—42.
- [6] Агеев В. Н., Ионов Н. И. // ФТТ. 1969. Т. 11. № 11. С. 3200—3209.
- [7] Ageev V. N., Burmistrova O. P., Yakshinskii B. V. // Surf. Sci. 1988. V. 194. N 1—2. P. 101—114.
- [8] Clinton W. L., Jutila R. E. // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. N 10. P. 6441—6446.

- [9] Gortel Z. W., Kreuzer H. J., Feulner P., Menzel D. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. N 17. P. 8951—8968.
- [10] Gortel Z. W. // Surf. Sci. 1990. V. 231. N 1—2. P. 193—212.
- [11] Hübner W., Brenig W. // Z. Phys. B. 1989. V. 74. N 3. P. 361—367.
- [12] Antoniewicz P. R. // Phys. Rev. B. 1980. V. 21. N 9. P. 3811—3815.
- [13] Zhang Q.-J., Gomer R., Bowman D. R. // Surf. Sci. 1983. V. 129. N 2—3. P. 535—562.
- [14] Moog E. R., Unguris J., Webb M. B. // Surf. Sci. 1983. V. 134. N 3. P. 849—864.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакцию
9 января 1991 г.